29a-A4-9

aSi:H/cSi ヘテロ接合太陽電池のデバイスモデルと Voc の i 層厚依存性

Device model of aSi:H/cSi heterojunction solar cells and Voc dependence on i-aSi:H layer thickness

豊田工大¹, SILVACO Japan²,明治大³, 産総研⁴,林 豊^{1,4}, Debin Li²,大下 祥雄¹,小椋 篤志³ Y. Hayashi^{1,4}, Debin Li², Y. Ohshita¹, A. Ogura³, Toyota Tech¹, SILVACO Japan², Meiji Univ.³, AIST⁴ e-mail: yuhay@ceres.ocn.ne.jp

[デバイスモデル] aSi:H/cSi ヘテロ接合太陽 電池¹⁾の受光面側結晶 Si (cSi) 表面には反 転層、裏面には多数キャリア蓄積層が aSi:H により図1に示す^{2),3)}ように誘起されている。 裏面の蓄積層は少数キャリアを受光面側へ追 い返す BSF (back surface field)を形成し、Jsc、 Voc の向上に寄与している。裏面接合のキャ リア輸送特性は、少数キャリアは阻止するが 多数キャリアを通す、太陽電池にとって理想

に近いオーム性接続を形成している。裏面の BSF²⁾、受 光面の反転層³⁾ は実デバイスで観測されている。光照 射下で cSi 断面の電位を超高抵抗プローブでモニタす ることによって、受光面接合の IV 特性と裏面接合の IV 特性を測り分けた例を図 2 に示す²⁾。図から判るよう に、裏面接合は主として外部電極とのオーミック接続 に寄与し、受光面接合は主として電圧発生に寄与して いる。

[simulation] この反転層の少数キャリア濃度と多数キ ャリア濃度は受光面接合の i-aSi:H 層厚によって変化す る。反転層-基板接合が Voc の主たる発生源であること を考えると、Voc は i-aSi:H 厚によって変化する。今回 は Voc の i-aSi:H 層厚依存性の simulation 結果を報告す る。simulator は SILVACO 社 ATLAS を用いた。表面反転層 キャリアは aSi:H の energy barrier と cSi の表面強電界によ り confine されているため量子効果を組み込んだ計算が必 要であり、ATLAS へ Quantum モジュールを導入した。 図 3 に simulation 結果の一例を示す。この例では i-aSi:H 厚 の増加にしたがって Voc は増加している。

図3の結果はi層の導入によりVocが増加する実験報告^{4),} ⁵⁾をよく説明している。変換効率最大を与えるi-aSi:H厚に ついては別途報告する。最適膜厚は使用するaSi:Hの材料 パラメータによって変化する。

[謝辞]本研究の一部は NEDO 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発「結晶 Si 太陽電池」の下で行われた。関係各位に感謝する。

[文献] 1) (history of HIT) M. Tanaka, et al., 4OD1001, WCPEC3, Kyoto,

(2003), 2) Y. Hayashi, et al., 16th NREL workshop on Crystalline Silicon

Solar Cells and modules, (2006), 3) Y. Hayashi, 17th NREL workshop on Crystalline Silicon Solar Cells and modules, (2007),. 4) Fig. 7 in M. Taguchi, et al., C-IIIa-1, International PVSEC-5, Kyoto, Japan, (1990),

5) D. Munos, et al, Fig. 17.21, on p.563 of van Sark, W., L. Korte, and F. Roca, eds. "Physics and technology of amorphous-crystalline heterostructure silicon solar cells.", Engineering Materials, 2012, Springer.



2 IV characteristics #6 dark and illiuminated







